

Cite No. 5





第 1 頁, 共 1 頁

esp@cenet document view






Radiation-polymerisable composition and process for applying markings to a solder resist layer.

Patent number: EP0157374
Publication date: 1985-10-09
Inventor: GEISSLER ULRICH DR DIPL-ING; LAMPAS HEIDE
Applicant: HOECHST AG (DE)
Classification:
- **International:** B23K35/22; C08G18/67; G03F7/027; H05K1/02; H05K3/28; B23K35/22; C08G18/00; G03F7/027; H05K1/02; H05K3/28; (IPC1-7): G03C1/68; G03F7/02; H05K3/34
- **European:** B23K35/22C; C08G18/67D; G03F7/027; H05K1/02D; H05K3/28G2
Application number: EP19850103766 19850328
Priority number(s): DE19843412992 19840406

Also published as:

 US4695527 (A)
 JP60237437 (A)
 EP0157374 (A)
 DE3412992 (A)

Cited documents:

 EP0131299
 EP0073444
 EP0063304
 GB2032939
 EP0021429
more >>

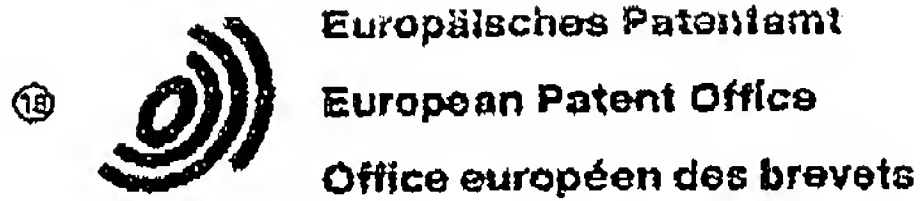
[Report a data error here](#)

Abstract not available for EP0157374

Abstract of corresponding document: **US4695527**

A photopolymerizable composition is disclosed which comprises: (a) a free-radically polymerizable compound, (b) a polymeric binder, (c) a photopolymerization initiator, (d) a compound which is thermally crosslinkable with the polymeric binder, with a polymerization product of (a) or with itself, and (e) a pigment. The disclosed composition is used for applying markings to printed circuits and preferably is applied to the solder-resist layer using a dry-resist process, is exposed and then developed, either separately or together with the solder-resist layer.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 157 374
A2

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 85103766.3

 ⑱ Int. Cl.⁴: **G 03 C 1/68, G 03 F 7/02,**
H 05 K 3/34

⑲ Anmeldetag: 28.03.85

⑳ Priorität: 05.04.84 DE 3412992

 ㉑ Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,**
Postfach 80 03 20, D-6230 Frankfurt am Main 80 (DE)

 ㉒ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 09.10.85
 Patentblatt 85/41

 ㉓ Benannte Vertragsstaaten: **AT BE CH DE FR GB IT LI NL**
SE

 ㉔ Erfinder: **Geissler, Ulrich, Dr. Dipl.-Ing.,**
Ruprechtstrasse 22, D-6000 Frankfurt/Main (DE)
Erfinder: Lampas, Holde, Neudorfstrasse 11,
D-6203 Hochheim/Main (DE)

 ㉕ Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch und Verfahren zum Aufbringen von Markierungen auf eine
 Lötstopresaltschicht.

 ㉖ Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch und Ver-
 fahren zum Aufbringen von Markierungen auf eine Lötstop-
 resaltschicht.

 Es wird ein photopolymerisierbares Gemisch beschrie-
 ben, das

- a) eine radikalisch polymerisierbare Verbindung
- b) ein polymeres Bindemittel
- c) einen Photopolymerisationsinitiator und
- d) eine mit dem Bindemittel (b), mit dem Polymerisa-
 tionsprodukt von (a) oder mit sich selbst thermisch vernetz-
 bare Verbindung und
- e) ein Pigment

 enthält. Das Gemisch dient zum Aufbringen von Kennzeich-
 nungen auf gedruckte Schaltungen und wird bevorzugt nach
 dem Trockenresistverfahren auf die Lötstopresaltschicht
 aufgebracht, belichtet und dann allein oder zusammen mit
 dieser entwickelt.

EP 0 157 374 A2

ACTORUM AG

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

84/K 026

- 1 -

26. März 1985
WLK-Dr.N.-ur

Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch und Verfahren
zum Aufbringen von Markierungen auf eine Lötstopresist-
schicht

5

Die Erfindung betrifft ein photopolymerisierbares
Gemisch, das sich, insbesondere in Form einer Trocken-
resistschicht, auf die Oberfläche einer gedruckten
Schaltung, besonders auf eine Lötstopresistschicht,
10 aufbringen und zu sichtbaren Markierungen verarbeiten
läßt.

Auf die Bestückungsseite von gedruckten Schaltungen wer-
den häufig Markierungen oder Kennzeichnungsmerkmale auf-
15 gebracht, die als Hilfe beim Bestücken mit Bauteilen
dienen. Die Markierungen werden gewöhnlich auf den
Lötstoplack aufgebracht, mit dem die Leiterplatte unter
Aussparung der Lötungen überzogen ist. Man verwendet für
diesen Zweck im wesentlichen pigmentierte Kennzeich-
20 nungslacke, die im Siebdruckverfahren aufgebracht werden.

Der Kennzeichnungslack muß eine gute Haftfestigkeit auf
der Unterlage, insbesondere auf dem Lötstoplack haben.
Die besten Ergebnisse werden mit Zweikomponentenlacken
25 erzielt. Die Verarbeitungs- oder Topfzeit eines fertigen
Zweikomponentenlacks beträgt im allgemeinen nicht mehr
als 6 bis 8 Stunden; er kann also nur innerhalb dieses
Zeitraums verarbeitet werden. Danach geliert die Mischung
und wird fest. Man hat auch versucht, Kennzeichnungslacke
30 auf Basis von Druckfarben einzusetzen, die durch UV-Licht

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 2 -

härtbar sind. Mit derartigen Lacken hat man aber bisher
nicht die gewünschte Haftfestigkeit erreicht. Wenn diese
Lacke auf einen vollständig polymerisierten Lötstop-
resist mit hohem Oberflächenglanz aufgedruckt werden, ist
5 die Verankerungsmöglichkeit reduziert.

Auch die Resistenz der UV-gehärteten Kennzeichnungen
unter den Bedingungen nachfolgender Verarbeitungsschritte
z. B. beim Löten und der daran anschließenden Reinigung
10 mit aggressiven Chemikalien und Reinigungsmitteln unter
Ultraschalleinwirkung, ist häufig unzureichend. Ein wei-
terer Nachteil ist das Absetzen des Pigments bei der
Lagerung. Auch ist die Erstellung einer Siebdruckscha-
blone allein für die Kennzeichnung in vielen Fällen mit
15 geringer Stückzahl zu aufwendig.

Andererseits ist es z. B. aus der EP-A 73 444 bekannt,
Lötstopmasken nach dem Trockenresistverfahren herzu-
stellen, indem eine photopolymerisierbare Schicht, die
20 polymere Bindemittel, polymerisierbare Verbindungen, Pho-
toinitiatoren und thermisch aktivierbare Vernetzungsmit-
tel enthält, auf die Schaltung laminiert, bildmäßig unter
Aussparung der Lötäugen belichtet, entwickelt und schließ-
lich thermisch gehärtet wird. Diese Schichten enthalten
25 gewöhnlich einen Farbstoff, der die entwickelte Lötstop-
maske visuell erkennbar macht. Auch kann man Farbstoffe
zusetzen, die beim Belichten ausbleichen oder ihren Farb-
ton verändern, um die belichteten von den unbelichteten
Stellen unterscheiden zu können. Hierbei muß man jedoch
30 darauf achten, daß die Lichtempfindlichkeit der photopo-

0157374

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 3 -

lymerisierbaren Schicht nicht beeinträchtigt wird. Man verwendet also Farbstoffe, die möglichst wenig im kurzwelligen Spektralbereich absorbieren, und setzt sie nur in relativ geringen Konzentrationen zu.

5

Aufgabe der Erfindung war es, ein Verfahren zum Aufbringen von Markierungen auf gedruckte Schaltungen vorzuschlagen, womit es möglich ist, auf die Oberfläche einer gedruckten Schaltung, d. h. auf die Lötstopmaske, fest haftende Markierungen bzw. Kennzeichnungsmerkmale ohne Erstellung einer Druckschablone aufzubringen, die gegenüber den Bedingungen und Behandlungsoperationen nachfolgender Bearbeitungsschritte, wie Löten und Reinigen, resistent sind.

15

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum Aufbringen sichtbarer Markierungen auf eine belichtete Lötstopresistschicht vorgeschlagen. Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß man eine feste thermoplastische photopolymerisierbare Schicht, die ein dispergiertes feinteiliges, zur Farbe der Lötstopresistschicht kontrastierendes Pigment enthält und sich auf einem transparenten flexiblen temporären Schichtträger befindet, unter Druck auf die belichtete und ggf. entwickelte Lötstopresistschicht laminiert, unter einem Negativ der Markierungszeichen belichtet und nach dem Abziehen des temporären Schichtträgers die unbelichteten Bereiche der photopolymerisierbaren Schicht mit einem Entwickler auswäscht.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 4 -

Erfindungsgemäß wird ferner ein durch Strahlung polymerisierbares Gemisch vorgeschlagen, das als wesentliche Bestandteile

- 5 a) eine Verbindung mit mindestens zwei endständigen ethylenisch ungesättigten Gruppen, die durch radikalisch initiierte Additionskettenpolymerisation ein vernetztes Polymerisat zu bilden vermag,
- 10 b) ein polymeres Bindemittel,
- c) einen durch Strahlung aktivierbaren freie Radikale bildenden Polymerisationsinitiator und
- 15 d) eine mit dem polymeren Bindemittel (b), mit dem Polymerisationsprodukt der Verbindung (a) und bzw. oder mit sich selbst thermisch vernetzbare Verbindung
- 20 enthält.

Das erfindungsgemäße Gemisch ist dadurch gekennzeichnet, daß es ferner e) ein in dem Gemisch dispergierbares feinteiliges Pigment enthält.

25

Die Komponente d) des Gemischs kann fortfallen, wenn das Bindemittel vernetzende Gruppen enthält, durch die es mit sich selbst oder mit dem Polymerisationsprodukt der ungesättigten Verbindung in der Wärme zu vernetzen vermag.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 5 -

- Als aktinische Strahlung, gegenüber der das erfindungs-
gemäße Gemisch empfindlich ist, kommt jede elektromagne-
tische Strahlung in Betracht, deren Energie zur Aus-
lösung einer Polymerisation ausreicht. Geeignet sind
5 insbesondere sichtbares und ultraviolettes Licht,
Röntgen-, und Elektronenstrahlung. Auch Laserstrahlung
im sichtbaren und UV-Bereich kann verwendet werden. Be-
vorzugt wird kurzwelliges sichtbares und nahes UV-Licht.
- 10 Als polymerisierbare Verbindungen werden im allgemeinen
Ester der Acryl- oder Methacrylsäure mit mehrwertigen,
vorzugsweise primären, Alkoholen verwendet. Der Alkohol
sollte 2 bis etwa 4 Hydroxygruppen enthalten, da durch
mehrfach ungesättigte Verbindungen die erwünschte Ver-
15 netzungswirkung erreicht wird. In untergeordneter Menge
können auch Ester von einwertigen oder höherwertigen
Alkoholen im Gemisch enthalten sein. Beispiele für ge-
eignete mehrwertige Alkohole sind Ethylenglykol, Propy-
lenglykol, Butandiol-1,4, Butandiol-1,3, Diethylenglykol,
20 Triethylenglykol, Polyethylenglykole oder Polypropylen-
glykole mit Molekulargewichten von etwa 200 bis 1000,
Neopentylglykol, Trimethylolethan und -propan, Penta-
erythrit und oxyethylierte Bisphenol-A-Derivate. Es sind
ferner die niedermolekularen, Urethangruppen enthalten-
25 den Bisacrylate und Bismethacrylate geeignet, die durch
Umsetzen von 2 mol Hydroxyalkylacrylat oder -methacrylat
mit 1 mol eines aliphatischen oder cycloaliphatischen
Diisocyanats, z. B. 2,2,4-Trimethyl-hexamethylendiiso-
cyanat, erhalten werden. Derartige Urethangruppen ent-
30 haltende Monomere sind in der US-A 4 088 498 beschrie-

HOECHST AG

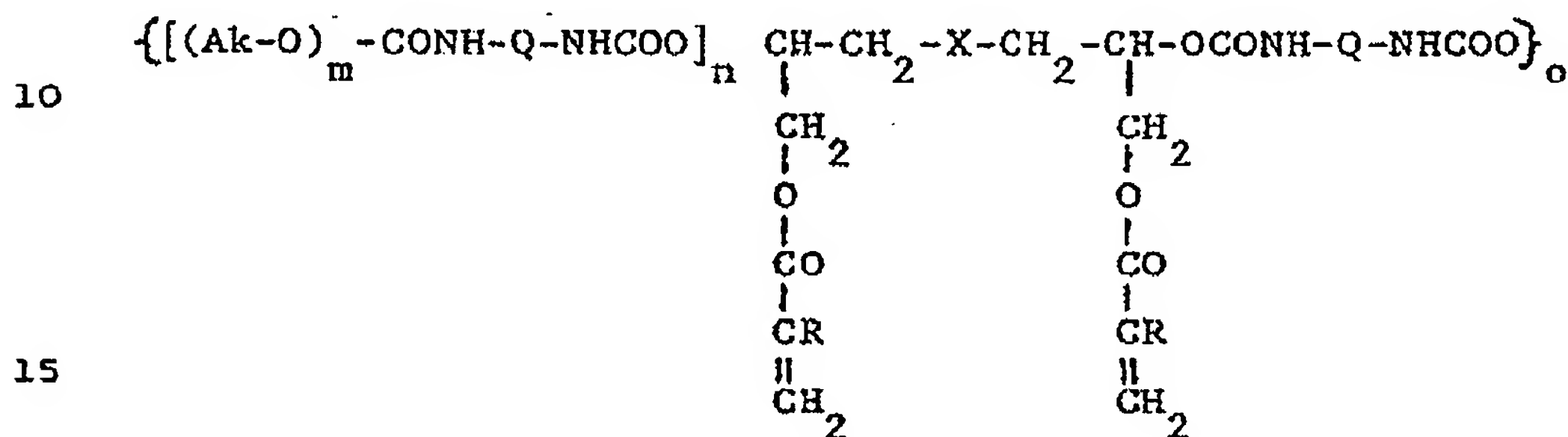
0157374

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 6 -

ben. Ähnlich geeignete Monomere sind in der EP-A 5750
und der EP-A 73 444 beschrieben.

Es können auch Gemische unterschiedlicher Monomere
5 verwendet werden. Zum Beispiel ist es möglich, Monomere
der oben angegebenen Art mit höhermolekularen, Urethan-
gruppen enthaltenden Monomeren der allgemeinen Formel



zu kombinieren, wobei

20 Q ein zweiwertiger ein- oder zweikerniger aromatischer
Rest, der unsubstituiert oder durch niedere Alkyl-
gruppen substituiert ist und der als Bindeglied eine
niedere Alkylengruppe enthalten kann,

X eine der Gruppen
-O-Ph-X'-Ph-O- und

25 -OOC-(CH₂)_y-COO-,
wobei Ph eine gegebenenfalls substituierte Phenyl-
gruppe, X' eine Alkylengruppe mit 1 - 4 Kohlenstoff-
atomen und y eine Zahl von 2 bis 12 ist,

R ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe,

30

0157374

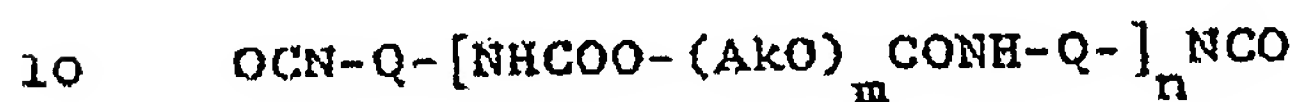
H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 7 -

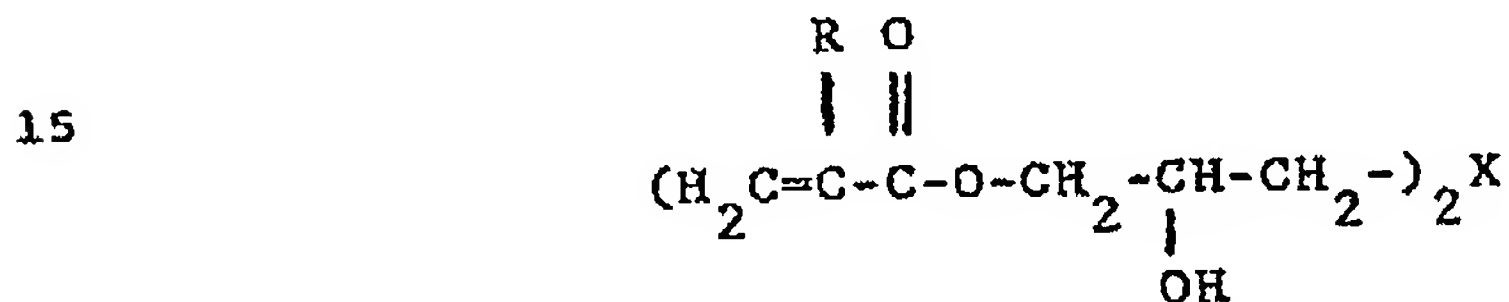
Ak ein Alkylenrest mit 2-4 Kohlenstoffatomen,
m eine Zahl von 4 bis 50,
n eine Zahl von 1 bis 6 und
o eine Zahl von 4 bis 20 ist.

5

Die Herstellung dieser Polyetheresterurethane erfolgt in bekannter Weise durch Umsetzen von oligomeren Diisocyanaten der Formel



mit Bis-acrylsäureester-diolen der Formel



20 Die Herstellung und Verwendung dieser Verbindungen ist in der EP-A 48 913 beschrieben.

Diese Polyurethane haben im allgemeinen reduzierte spezifische Viskositäten (RSV), gemessen an 1%igen Lösungen in
25 Dimethylformamid bei 25°C, von etwa 0,15 bis 1,4 dl/g.

Bevorzugt werden Produkte mit RSV-Werten im Bereich von 0,2 bis 0,9 dl/g.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 8 -

Bevorzugte mittlere Werte von m liegen bei 8-20, von n bei 2-4, von o bei 5-12 und von y bei 2-6.

5 X' ist eine Alkylengruppe, in der die freien Valenzen bevorzugt an einem C-Atom stehen. Bevorzugte Gruppen sind Methylen-, 1,1-Ethylen- und 2,2-Propylengruppen. R ist vorzugsweise eine Methylgruppe.

10 Die Gesamtmenge an polymerisierbaren Verbindungen liegt im allgemeinen zwischen 10 und 50, vorzugsweise bei 15 bis 45, Gew.-%, bezogen auf die nichtflüchtigen Anteile des Gemischs. Von dieser Menge können 2 bis 20, bevorzugt 5 bis 10 Gew.-%, auf die gleiche Basis bezogen, aus Polyurethanen der oben angegebenen allgemeinen
15 Formel bestehen.

Die erfindungsgemäßen Gemische enthalten ferner ein polymeres, bevorzugt gesättigtes Bindemittel. Vorzugsweise werden wasserunlösliche, in wäßrig-alkalischen Lösungen
20 lösliche oder mindestens quellbare Bindemittel verwendet. Als alkalilösllichmachende Gruppen können die Bindemittel Phosphonsäure-, Sulfonsäure-, Sulfonamid-, Sulfonylurethan-, Carbonsäureanhydrid- und bevorzugt Carboxylgruppen enthalten. Bevorzugte Bindemittel sind Misch-
25 polymerisate aus Methacrylsäure und Alkylmethacrylaten und gegebenenfalls noch Styrol oder anderen Comonomeren, wie sie in den DE-A 20 64 080 und 23 63 806 beschrieben sind. Besonders bevorzugt werden Bindemittel, die seiteständig thermisch vernetzbare Gruppen enthalten, z. B.
30 Gruppen der Formel $-\text{CH}_2\text{OR}$, worin R ein Wasserstoffatom

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 9 -

oder eine niedere Alkyl- oder Acylgruppe ist. Die Gruppen
können an Sauerstoff- oder Stickstoffatomen stehen, z. B.
in Einheiten von Acryl- bzw. Methacrylamid oder -säure-
estern. Derartige Bindemittel sind in der älteren deut-
5 schen Patentanmeldung P 33 29 443.7 beschrieben, z. B.
Terpolymerisate von Methacrylsäure, Alkylmethacrylaten
und N-Alkoxymethyl-methacrylamiden. Die Bindemittel wer-
den in einer Menge von 40 bis 80, vorzugsweise 50 bis 70
Gew.-%, der nichtflüchtigen Bestandteile des Gemischs
10 verwendet.

Als Photoinitiatoren in dem erfindungsgemäßen Gemisch
können eine Vielzahl von Substanzen Verwendung finden.
Beispiele sind Benzoin und seine Derivate, Mehrkern-
15 chinone, Trichlormethyl-s-triazine, Trihalogenmethyl-
gruppen enthaltende Carbonylmethylenheterocyclen, z. B.
2-(p-Trichlormethyl-benzoylmethylen)-3-ethyl-benzthiazol-
in, Acridinderivate, z. B. 9-Phenyl-acridin, 9-p-Meth-
oxy-phenyl-acridin, 9-Acetylamino-acridin, Benz(a)acri-
20 din; Phenazinderivate, z. B. 9,10-Dimethylbenz(a)phenazin,
9-Methyl-benz(a) phenazin, 10-Methoxybenz(a)-phenazin,
Chinoxalinderivate, z. B. 6,4',4"-Trimethoxy-2,3-di-
phenylchinoxalin, 4',4"Dimethoxy-2,3-diphenyl-5-azachin-
oxalin oder Chinazolinderivate. Die Acridin-, Phenazin-
25 und Chinoxalinderivate werden bevorzugt. Die Photo-
initiatoren werden allgemein in einer Menge von 0,01 bis
10, vorzugsweise von 0,05 bis 2 Gew.-% verwendet.

Die erfindungsgemäßen Gemische enthalten außerdem etwa
30 1 - 30 Gew.-% eines anorganischen oder organischen Pig-
ments. Der Pigmentanteil ist abhängig von der Art des

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 10 -

Pigments und der Schichtdicke. Er liegt bevorzugt zwischen 5 und 15 Gew.-%, besonders bei einer Dicke der Schicht um 25/ μ m. Unter den anorganischen Pigmenten sind Oxid- und Hydroxid-Pigmente (z.B. Titandioxid, Zinkoxid),
5 Sulfidpigmente (z.B. Zinksulfid, Cadmiumpigmente), Chromatpigmente (z.B. Chromgelb, Chromorange, Zinkgelb) zu nennen. Beispiele für organische Pigmente sind Mono- und Bisazopigmente, schwerlösliche Salze von anionischen Azofarbstoffen, schwerlösliche Salze von kationischen
10 Farbstoffen, Kupferphthalocyanine und sonstige Metallkomplexpigmente, Pigmente aus der Gruppe der Carbonyl-Farbstoffe, Azin- und Dioxazinpigmente.

Vorzugsweise enthalten die Gemische zusätzlich geringe
15 Mengen eines Farbstoffs, der bei Bestrahlung seine Farbe ändert, wodurch unmittelbar nach der Belichtung bereits das Bild in der Schicht zu erkennen ist.

Als Farbstoffe, die bei Belichtung einen Farbumschlag
20 zeigen, sind z. B. Triphenylmethanfarbstoffe und bestimmte Azofarbstoffe, wie sie in der DE-A 28 07 933 (= US-A 4 241 166) beschrieben sind, geeignet.

Als Verbindungen, die mit dem Bindemittel, dem Poly-
25 merisationsprodukt der ethylenisch ungesättigten Verbindung und/oder mit sich selbst thermisch vernetzbar sind, sind bevorzugt solche geeignet, die als vernetzende Gruppen Epoxygruppen oder Gruppen der Formel $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{R}$ enthalten, worin R ein Wasserstoffatom, eine niedere Alkyl-,
30 Acyl- oder Hydroxyalkylgruppe ist und in denen die

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 11 -

Gruppen $-CH_2OR$ an einem Stickstoffatom eines offenkettigen oder cyclischen Säureamids oder an einem aromatischen Kohlenstoffatom einer zur Kondensation mit Formaldehyd befähigten Verbindung stehen. Die organischen
5 Reste R enthalten im allgemeinen 1 bis 4, bevorzugt 1 bis 2 Kohlenstoffatome.

Bevorzugt werden Derivate cyclischer Säureamide, z. B. von Melamin, insbesondere Hexaalkoxymethylmelamin.

10

Die vernetzenden Verbindungen sind in dem Gemisch gewöhnlich in einer Menge von etwa 0,5 bis 30, vorzugsweise 5 bis 25 Gew.-%, bezogen auf seine nichtflüchtigen Bestandteile, enthalten.

15

Die erfindungsgemäßen Gemische können außer Monomeren, Bindemitteln, Photoinitiatoren, Vernetzern und Pigmenten noch eine Reihe weiterer üblicher Zusätze enthalten, z.B. Inhibitoren zur Verhinderung der thermischen Polymerisation der Monomeren, Wasserstoffdonatoren, sensitometrische Regler, Flammenschutzmittel und Weichmacher.

20

Das erfindungsgemäße Gemisch findet bevorzugt Anwendung als Kennzeichnungsresist. Dazu kann es in bekannter Weise
25 aus einer Lösung (bzw. Dispersion) oder als vorgefertigte übertragbare Trockenresistfolie auf eine Leiterplatte, die bevorzugt mit einer Lötstopmaske abgedeckt ist, aufgebracht werden. Das Gemisch wird bevorzugt als Trockenresistmaterial verarbeitet. Im allgemeinen wird eine
30 Lösung des Gemischs in einem Lösemittel auf einen geeigneten

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 12 -

neten Schichtträger, z. B. eine Polyesterfolie, auf-
gebracht und getrocknet. Die Schichtdicke der Resist-
schicht kann etwa 10 bis 50, vorzugsweise 20 bis 30 μ m
betragen. Die freie Oberfläche der Schicht wird vorzugs-
5 weise mit einer Deckfolie, z. B. aus Polyethylen oder
Polypropylen, abgedeckt.

Die Resistrollen bleiben auch nach einer Lagerung von
Monaten bei 20°C unverändert und lassen sich problemlos
10 verarbeiten, die Schnittkanten sind völlig frei von zur
Verklebung führenden Resistaustritten. Die über 2 Monate
bei 40°C im Trockenschrank gelagerten Resistschichten
zeigen gegenüber frisch hergestellten Schichten keinen
Unterschied bezüglich Laminierbarkeit, Entwickelbarkeit
15 und Lötresistenz.

Die Folien lassen sich mit in der Trockenresisttechnik
üblichen Geräten verarbeiten. In einer handelsüblichen
Laminiervorrichtung wird die Deckfolie abgezogen und die
20 Kennzeichnungsresistschicht auf eine mit einer Lötstop-
resistschicht überzogene und durch eine Vorlage belich-
tete Leiterplatte laminiert. Die Kennzeichnungsresist-
schicht kann auch auf eine mit einer entwickelten Löt-
stopmaske bedeckte Leiterplatte laminiert werden. Die
25 so präparierte Platte wird dann durch eine Vorlage
belichtet, wobei nur die Schichtteile vom Licht getroffen
werden, die die Kennzeichnung bzw. die Markierung bilden
sollen.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 13 -

Entwickelt werden die von der Trägerfolie befreiten
Resistschichten in bekannter Weise, entweder Lötstop-
resistschicht und Kennzeichnungsresistschicht gemeinsam
oder nur die Kennzeichnungsresistschicht. Als Entwickler
5 sind wäßrige, vorzugsweise wäßrig-alkalische Lösungen,
z. B. von Alkaliphosphaten, -carbonaten oder -silikaten,
geeignet, denen gegebenenfalls kleine Mengen, z. B. bis
zu 10 Gew.-% an mit Wasser mischbaren organischen
Lösungsmitteln oder Netzmitteln zugesetzt werden können.

10

Die mit Lötstopmaske und Kennzeichnung versehenen
Leiterplatten müssen nun vor dem Lötprozeß einer Tem-
peraturbehandlung unterzogen werden.

15 Es wird angenommen, daß sich hierbei ein interpenetrie-
rendes Netzwerk ausbildet, das eine gute mechanische,
thermische und chemische Resistenz bewirkt. Diese ther-
mische Behandlung erfolgt im allgemeinen zwischen 130°C
und 150°C, bei ungefähren Behandlungszeiten von 30 bis
20 60 Minuten.

Die Leiterplatte kann nach den mit Hilfe des Kennzeich-
nungsresists aufgebraachten Markierungen und Bauteile-
kennzeichnungen mit elektronischen Bauelementen bestückt,
25 anschließend mit einem geeigneten handelsüblichen Fluß-
mittel behandelt und dann auf einer handelsüblichen
Schwall-Lötmaschine gelötet werden.

Mit Hilfe der Resisttechnik können Markierungen und Bau-
30 teilekennzeichnungen schnell und präzise auf Leiterplat-

0157374

HOECHST AKTIENGESellschaft
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 14 -

ten aufgebracht werden. Der Kennzeichnungsresist besitzt eine gute Haftung insbesondere auf Lötstopmasken, er ist bei den üblichen Löttemperaturen beständig und zeigt auch eine ausreichende Resistenz gegenüber Chemikalien, Reinigungsmitteln und Ultraschallbehandlung. Überraschenderweise wird die Kennzeichnungsresistschicht trotz des relativ hohen Anteils an Pigment und der dadurch hervorgerufenen hohen optischen Dichte innerhalb praktikabler Belichtungszeiten so weit durchgehärtet, daß auch kleine
5
10 Zeichen beim Entwickeln nicht von der Lötstopresistschicht abgewaschen werden.

Die folgenden Beispiele erläutern einzelne Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Gemischs. Wenn nichts
15
anderes angegeben ist, sind Prozentzahlen und Mengenverhältnisse in Gewichtseinheiten zu verstehen. Die Mengen sind in den Rezepturen in Gewichtsteilen (Gt) angegeben.

20 Beispiel 1

In einer Korundmühle wurden 3 Gt Titandioxid Kronos RNCX der Firma Kronos Titan GmbH mit 14 Gt einer 30 %igen Lösung eines Styrol-Hexylmethacrylat-Methacrylsäure-Copolymeren (10:60:30 Gew.-%) in Butanon innig vermischt.

25
Anschließend wurden unter Rühren folgende Bestandteile zu dieser Dispersion gegeben:

30 29,33 Gt der oben erwähnten 30 %igen Terpolymerenlösung,

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 15 -

- 1,6 Gt eines elastomeren Reaktionsprodukts aus
Glycidylmethacrylat, Adipinsäure und einem
oligomeren Diisocyanat, das durch Umsetzen von
Tolylendiisocyanat mit einem Poly-butan-1,4-
diol erhalten worden war (vgl. DE-A 30 36 694),
5 7,4 Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
0,01 Gt 9-Phenylacridin,
1,0 Gt Hexamethoxymethyl-melamin,
0,0075 Gt eines blauen Azofarbstoffs, erhalten durch
Kuppeln von 2,4-Dinitro-6-chlor-benzol-
diazoniumsalz mit 2-Methoxy-5-acetylamino-
N,N-diethylanilin und
10 11 Gt Ethanol.

- 15 Mit der angegebenen Mischung wurde eine biaxial ver-
streckte und thermofixierte Polyethylenterephthalatfolie
der Stärke 25,um kontinuierlich beschichtet. Nach Durch-
laufen einer Trockenzone hatte die Resistschicht eine
Dicke von 25,um und wurde mit einer Polypropylenfolie
20 abgedeckt.

- Die Trockenresistschicht wurde nach Abziehen der Poly-
propylenfolie mit einer handelsüblichen Laminier-
vorrichtung bei 115°C (a) auf eine mit einer photopolymerisier-
baren Lötstopresistschicht überzogene und durch eine
25 Vorlage belichtete Leiterplatte laminiert.

Die photopolymerisierbare Lötstopresistschicht hatte die
folgende Zusammensetzung:

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 16 -

- 13 Gt eines Terpolymeren aus n-Hexylmethacrylat,
Methacrylsäure und Styrol (60:30:10) mit
einem mittleren Molgewicht von ca. 35000
und der Säurezahl 195,
- 5 6,4 Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
1,6 Gt des oben angegebenen polymerisierbaren
Elastomeren,
0,2 Gt 9-Phenylacridin,
0,41 Gt Hexamethoxymethyl-melamin,
- 10 0,01 Gt des oben angegebenen blauen Azofarbstoffs und
0,03 Gt 1,4-Bis-(4-tert.-butoxy-phenylamino)-5,8-
dihydroxy-anthrachinon.

Bei einer zweiten Probe (b) wurde die Resistschicht auf
15 eine mit Lötstopresist beschichtete, belichtete und ent-
wickelte Leiterplatte laminiert.

Die Platten wurden 12 Sekunden mit einem handelsüblichen
Belichtungsgerät (5 kW-Metallhalogenidlampe) belichtet.

20 Als Vorlage diente neben einem Kennzeichnungsdruck-Negativ
ein 13-stufiger Halbtonstufenkeil mit Dichteinkrementen von
0,15. Anschließend wurden die Platten mit 1 %iger Soda-
lösung in einem Durchlaufentwicklungsgerät entwickelt. Es
wurden drei vollvernetzte Keilstufen erhalten. Bei einer

25 Entwicklertemperatur von 30°C betrug die Entwicklungszeit
für den Kennzeichnungsresist (b) 60 Sekunden, die gemein-
same Entwicklung von Lötstopresist und Kennzeichnungsresist
(a) erforderte 220 Sekunden.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 17 -

Die so präparierten Leiterplatten wurden dann in einem Trockenschrank 60 Minuten bei 150°C gehärtet und anschließend auf einer Schwallötanlage gelötet. Die gelöteten Platten zeigten keinerlei Abplatzungen des Kennzeichnungsresists. Auch feinste Buchstaben oder Zahlen konnten nicht mit einem Klebeband abgezogen werden.

Beispiel 2

Es wurde eine Beschichtungslösung wie in Beispiel 1 bereitet, die anstelle der dort eingesetzten Menge Polyethylenglykol-400-dimethacrylat 7,4 Gt einer Mischung dieses Monomeren mit dem Reaktionsprodukt aus 1 mol Triethylenglykol, 2 mol 2,2,4-Trimethylhexamethylen-diisocyanat und 2 mol Hydroxyethylmethacrylat im Gewichtsverhältnis 4,4 : 3 enthielt.

Die Mischung wurde auf eine Polyethylenterephthalatfolie so aufgeschleudert, daß nach dem Trocknen bei 100°C ein Schichtgewicht von 28 g/m² erhalten wurde.

Der Kennzeichnungsresist wurde wie im Beispiel 1 weiterverarbeitet.

Belichtungszeit:	20 Sekunden
25 Entwicklungszeit (1%ige Sodalösung):	100 Sekunden
Anzahl der vernetzten Keilstufen:	3 (4)
Tempern:	60 Minuten bei 150°C

Auch hier waren nach dem Löten keinerlei Abplatzungen des Kennzeichnungsresists zu beobachten.

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 18 -

Beispiel 3

Es wurden folgende Mischungen hergestellt:

5	a)	39	Gt eines Terpolymerisats aus 25 Gew.-% N-Butoxymethyl-methacrylamid, 25 Gew.-% Methacrylsäure und 50 Gew.-% Hexylmethacrylat,
		9	Gt Titandioxid wie in Beispiel 1,
		9	Gt Hexamethoxymethyl-melamin,
10		16,2	Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
		0,0225	Gt des in Beispiel 1 erwähnten blauen Farbstoffs und
		0,03	Gt 9-Phenylacridin in
		100	Gt Butanon und
15		20	Gt Ethanol

20	b)	39	Gt des oben angegebenen Terpolymerisats,
		9	Gt Titandioxid (wie oben),
		3	Gt Hexamethoxymethyl-melamin,
20		22,2	Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
		0,0225	Gt des blauen Farbstoffs aus Beispiel 1 und
		0,03	Gt 9-Phenylacridin in
		100	Gt Butanon und
		20	Gt Ethanol

25

Nach dem Mischen in einer Korundmühle wurden die Beschichtungs-
lösungen jeweils auf eine Polyesterfolie aufgeschleudert und getrocknet (Schichtgewicht 30 g/m²). Die weitere
Verarbeitung erfolgte wie in Beispiel 1a, jedoch wurde auf
30 eine belichtete Lötstopresistschicht der folgenden Zusammensetzung laminiert:

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 19 -

- 52 Gt eines Terpolymerisats aus N-Butoxymethyl-
 methacrylamid, Methacrylsäure und Hexyl-
 methacrylat (25:25:50),
- 17,6 Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
- 5 4 Gt Hexamethoxymethyl-melamin,
- 0,8 Gt 9-Phenylacridin,
- 0,04 Gt des in Beispiel 1 angegebenen blauen
 Azofarbstoffs,
- 0,12 Gt 1,4-Bis-(4-tert.-butoxy-phenylamino)-5,8-
10 dihydroxy-anthrachinon.

Die optimale Belichtungszeit betrug für Schicht (a) 16 Se-
kunden, für Schicht (b) 12 Sekunden. Die Anzahl der voll-
vernetzten Keilstufen nach dem Entwickeln betrug jeweils
15 3 (4). Die Platten wurden anschließend 60 Minuten bei
150°C getempert. Die so aufgebrachte Kennzeichnung haf-
tete ausgezeichnet auf der Lötstopmaske. Auch nach 3-
tägiger Einwirkung von Ethanol war keine Ablösung zu
beobachten. Die Lötbadbeständigkeit war hervorragend.

20

Ähnlich gute Ergebnisse wurden erhalten, wenn anstelle
des Titandioxids die gleiche Menge Chromgelb verwendet
wurde.

25 Beispiel 4

Eine Lösung aus

- 39 Gt des in Beispiel 1 angegebenen
 Terpolymerisats,
- 13 Gt eines N-Methoxymethyl-methacrylamid-
30 Hexylmethacrylat-Copolymerisats (1:1),

0157374

HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 20 -

8 Gt des in Beispiel 1 angegebenen polymeri-
sierbaren Elastomeren,
22 Gt Polyethylenglykol-400-dimethacrylat,
12 Gt Titandioxid wie in Beispiel 1,
5 5 Gt Hexamethoxymethyl-melamin,
1 Gt 9-Phenylacridin,
0,03 Gt des blauen Azofarbstoffs aus Beispiel 1
und
210 Gt Butanon

10 wurde auf eine mit einer belichteten Lötstopresistschicht
beschichtete Leiterplatte so aufgeschleudert, daß nach
dem Trocknen ein Schichtgewicht von 27 g/m² erhalten
wurde. Die Platte wurde wie in Beispiel 1 (a) weiter-
15 verarbeitet, wobei ähnliche Ergebnisse wie dort erhalten
wurden.

20

25

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
K A L L E N i e d e r l a s s u n g d e r H o e c h s t A G

84/K 026

- 21 -

26. März 1985
WLK-Dr.N.-ur

Patentansprüche

1. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch, das als
wesentliche Bestandteile

5

a) eine Verbindung mit mindestens zwei endständigen
ethylenisch ungesättigten Gruppen, die durch radika-
lisch initiierte Additionskettenpolymerisation ein
vernetztes Polymerisat zu bilden vermag,

10

b) ein polymeres Bindemittel,

c) einen durch Strahlung aktivierbaren freie Radikale
bildenden Polymerisationsinitiator und

15

d) eine mit dem polymeren Bindemittel (b), mit dem
Polymerisationsprodukt der Verbindung (a) und bzw.
oder mit sich selbst thermisch vernetzbare Verbin-
dung

20

enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das Gemisch ferner

e) ein in dem Gemisch dispergierbares feinteiliges
Pigment

25

enthält.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 22 -

2. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es das Pigment in einer Menge von 1 - 30 Gew.-%, bezogen auf den Gehalt an nichtflüchtigen Bestandteilen, enthält.

5

3. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es ferner einen Farbstoff enthält, der bei Bestrahlung seine Farbe ändert.

10

4. Durch Strahlung polymerisierbares Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die thermisch vernetzbare Verbindung (d) eine Verbindung mit mindestens zwei Epoxygruppen oder mindestens zwei Gruppen der Formel
15 $-CH_2-O-R$ ist, wobei R ein Wasserstoffatom, eine niedrigere Alkyl-, Acyl- oder Hydroxyalkylgruppe ist.

5. Verfahren zum Aufbringen sichtbarer Markierungen auf eine belichtete Lötstopresistschicht, dadurch gekennzeichnet, daß man eine feste thermoplastische photopolymerisierbare Schicht, die ein dispergiertes feinteiliges zur Farbe der Lötstopresistschicht kontrastierendes Pigment enthält und sich auf einem transparenten flexiblen temporären Schichtträger befindet, unter Druck auf die
20 belichtete und ggf. entwickelte Lötstopresistschicht laminiert, unter einem Negativ der Markierungszeichen belichtet und nach dem Abziehen des temporären Schichtträgers die unbelichteten Bereiche der photopolymerisierbaren Schicht mit einem Entwickler auswäscht.

30

0157374

H O E C H S T A K T I E N G E S E L L S C H A F T
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 23 -

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß man die Lötstopresistschicht und die pigmentierte
photopolymerisierbare Schicht so auswählt, daß beide mit
dem gleichen Entwickler verarbeitet werden können, daß
5 man die pigmentierte photopolymerisierbare Schicht vor
dem Entwickeln der Lötstopresistschicht auf diese lami-
niert und daß man beide Schichten in einem Arbeitsgang
entwickelt.

10

15

20

25

30

46.